

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】平成19年10月18日(2007.10.18)

【公表番号】特表2003-514944(P2003-514944A)

【公表日】平成15年4月22日(2003.4.22)

【出願番号】特願2001-539025(P2001-539025)

【国際特許分類】

C 09 B	23/00	(2006.01)
D 06 P	3/32	(2006.01)
D 06 P	3/60	(2006.01)
D 21 H	17/12	(2006.01)
D 21 H	21/28	(2006.01)

【F I】

C 09 B	23/00	L
D 06 P	3/32	B
D 06 P	3/60	A
D 21 H	17/12	
D 21 H	21/28	A

【手続補正書】

【提出日】平成19年8月31日(2007.8.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

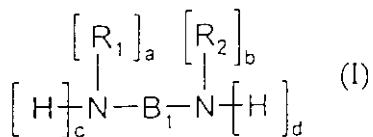
【請求項1】第一の工程において、ジアミンを、2個の脱離基又はN-アルキル化可能な基を含有する化合物少なくとも2.5当量と反応させ、

第二の反応工程において、芳香族N-含有複素環式化合物もしくは求核性化合物又はそれらの混合物と反応させ、

第三の反応工程において、アルデヒドと反応させ、そして最後に第四の反応工程において、無機酸又は有機酸と混合することにより得ることができる化合物又はそれらの混合物。

【請求項2】第一の反応工程において、以下の式(I)

【化1】



(式中、R₁及びR₂は独立に置換もしくは未置換C₁₋₄アルキル又は置換もしくは未置換フェニルであり、

B₁はC₂₋₁₀アルキレンであり、それは場合により、N、O及びSからなる群より選ば

れる 1 個以上の原子により遮られていてよく、そしてそれはさらに置換されていてよく、
a、b、c 及び d は各々、0、1 又は 2 であり、但し、合計 $a + c = 2$ 及び合計 $b + d = 2$ である) のジアミンを、10 ~ 50 の温度で、

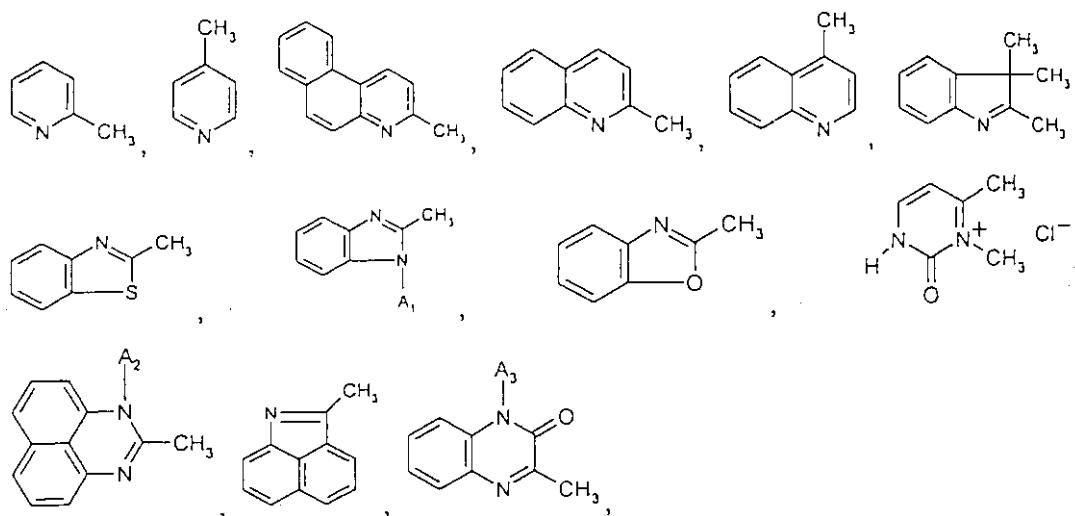
式 X B₂Y

(式中、B₂はC_{1~10}アルキレンであり、それは場合により、N、O 及び S からなる群より選ばれる 1 個以上の原子により遮られていてよく、そしてそれはさらに置換されていてよく、

X 及び Y は独立に、脱離基又は N をアルキル化するのに適切な基である) の化合物少なくとも 2.5 当量と反応させ、そして、

第二の反応工程において、その反応溶液を 1 種の化合物 D 又は複数種の化合物 D と 70 ~ 150 の温度で反応させ、そして D は以下の化合物、

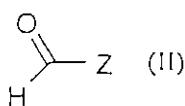
【化 2】



(式中、A₁、A₂ 及び A₃ は独立に、C_{1~4}アルキル、ベンジル、シクロヘキシリル、ヒドロキシアルキル又はC_{2~3}アルケニルであり、そして上記基の環は未置換であっても又はハロゲン、シアノ、C_{1~4}アルキル、C_{1~4}ヒドロキシアルキル又はC_{1~4}アルコキシによって置換されていてよい) のいずれかであるか、又は、D は求核性化合物であり、そして第三の反応工程において、その反応溶液を

式 (II)

【化 3】



(式中、Z は未置換であるか又はヒドロキシリル、アルコキシカルボニル、N - 置換もしくは未置換カルバモイル、アルキル、アルコキシ、アミノ又は置換アミノによって置換され

たフェニル、未置換であるか又はアルキル、アルコキシ、ヒドロキシル、カルボキシルもしくは(置換アミノ)置換されたナフチル、スチリル、フリル、チエニル、ピリジル、インドリル、ベンゾフリル、ベンゾチエニル、ピラゾリル、オキサゾリル、チアゾリル、トリアゾリル、オキサジアゾリル、チアジアゾリル、ベンズイミダゾリル、インダゾリル、ベンズオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、カルバゾリル、フェノチアジニル又はフェノキサジニルである)の化合物又はそれらの混合物と70~150の温度で反応させ、そして

第四の反応工程において、その反応溶液を有機酸又は無機酸と混合することにより得ることができる、請求項1記載の化合物又はそれらの混合物。

【請求項3】 R₁及びR₂は独立に、メチル又はエチルであり、

B₁はC_{2~6}アルキレンであり、それは場合により、N、O及びSからなる群より選ばれる1個以上の原子によって遮られていてよく、そしてさらに置換されていてよく、

a及びbは独立に0又は1であり、

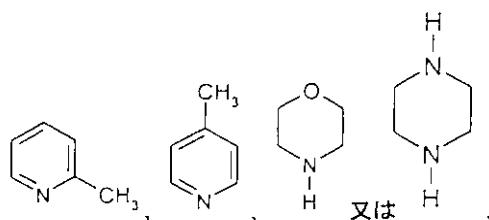
B₂はC_{1~4}アルキレンであり、それは場合により、N、O及びSからなる群より選ばれる1個以上の原子によって遮られていてよく、そしてさらに置換されていてよく、

Xはハロゲンであり、

Yはエポキシドであり、

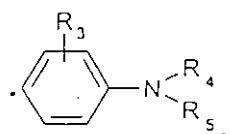
Dは

【化4】



であり、Zは

【化5】



であり、符号*は-CHO基への結合を表わし、そしてR₃、R₄及びR₅は独立にH又はC_{1~4}アルキル基であり、そして第四の反応工程において塩化水素酸、硫酸、リン酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、グリコール酸、クエン酸、乳酸又はグルコン酸が使用されることを特徴とする、請求項1又は2記載の化合物又はそれらの混合物。

【請求項4】 前記反応溶液は化合物Dの混合物と反応されることを特徴とする、請

求項 1、2 又は 3 に記載の化合物又はそれらの混合物。

【請求項 5】 前記反応温度は第一の反応工程において 15 ~ 40 であり、そして第二及び第三の反応工程において 80 ~ 120 であることを特徴とする、請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項記載の化合物又はそれらの混合物。

【請求項 6】 貯蔵安定な液体水性染料配合物を製造するための水溶性の形での請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項記載の化合物又はそれらの混合物の使用。

【請求項 7】 有機基材を染色又はプリントするための請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項記載の化合物又はそれらの混合物の使用又は請求項 6 記載の貯蔵安定な液体水性染料配合物の使用。

【請求項 8】 セルロース、綿、ケラチン系基材又はレザーを有機基材として使用することを特徴とする、請求項 7 記載の使用。

【請求項 9】 請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項記載の化合物又はそれらの混合物又は請求項 6 記載の貯蔵安定な液体水性染料配合物によって染色され又はプリントされた有機基材。

【請求項 10】 セルロース、綿、ケラチン系基材又はレザーであることを特徴とする、請求項 9 記載の有機基材。